(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-67516

(43)公開日 平成10年(1998) 3月10日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
C01G 23/053			C 0 1 G	23/053				
B 0 1 J 2/00			B 0 1 J	2/00			В	
13/00				13/00			В	
35/02				35/02			J	
C 0 3 C 17/25			C 0 3 C	17/25			Α	
		審查請求	未請求 請	求項の数 2	FD	全	6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-124865		(71)出廊	人 590003	3722			
				佐賀県	ŀ			
(22) 出顧日	平成9年(1997)4月	Α Δ	佐賀県	佐賀市	城内 1	丁目1-	59	
			(72)発明	者 一ノ瀬	1 弘道			
(31)優先権主張番号	特願平8-135762		佐賀県杵島郡有明町大字田野上1516					
(32)優先日	平8 (1996) 5月7日	I	(74)代理		: 米澤		(\$\ 7:	
(33)優先権主張国	日本(JP)							
			l					
			1					
•								

(54) 【発明の名称】 アナターゼ分散液およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 常温で長期安定性があり、中性で適用範囲が 広く、乾燥焼成で有害物質を発生しない、酸や有機物を 含まないアナターゼ分散液体。

【解決手段】 酸化チタン、水酸化チタン等を過酸化水素で処理して得られた溶液を加熱処理することによって、表面をペルオキソ基で修飾したアナターゼ微粒子を水中に分散したアナターゼ分散液。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アナターゼ分散液において、表面をペルオキソ基で修飾したアナターゼ微粒子が、水中に分散していることを特徴とするアナターゼ分散液。

【請求項2】 アナターゼ分散液の製造方法において、チタン含有液体から沈殿形成によって形成した水酸化チタン、もしくはチタン酸化物を水中に分散した液に、過酸化物を添加してペルオキソチタン溶液とした後に、ペルオキソチタン溶液を、85℃~200℃において、40時間~2時間の加熱処理を行うことを特徴とするアナターゼ分散液の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基体上に酸化チタンを含む保護被膜膜、光触媒被膜等の形成に使用することが可能な安定なアナターゼ分散液に関するものである。

[0002]

【従来の技術】チタン含有物質をガラス、白磁器、金属、建材、プラスチックス等の各種材料へ塗布、乾燥あるいは低温で焼き付けることにより、酸化チタンからなる保護被膜、光触媒、誘電体膜、半導体膜、紫外線カット被膜、着色コーティングなどを形成することが行われている。

【0003】酸化チタンの被膜の形成方法としては、酸化チタンの微粒子を含有した分散液等を塗布、乾燥、焼成する等の方法によって形成する方法が知られている。例えば、基体上にチタンアルコキシドから、ゾルゲル法で作製した分散液を塗布乾燥する方法、チタンアルコキシドを直接に塗布、乾燥した後に、焼成する方法が知られている。これらの方法では、酸や有機物質を含むので、塗布膜を焼成する際には高温に加熱してこれらの有機物質を除去することが必要であった。また、得られた被膜は、不均質あるいは多孔質膜の膜となりやすいという問題もあった。

【0004】また、チタン含有化合物の水溶液から作製した分散液も、分散剤として塩酸などの酸や有機分散剤を用いなければならず、その場合でも、常温で放置すると数時間から数日で微粒子のゲル化や凝集が起こり、その安定性が極めて悪かつた。

【0005】また、酸を含んでいるので、塗布できる材料が制限され、焼成の段階で有害なハロゲン化合物を生成した。さらに、密着性良く緻密な膜を得るためには、焼成温度は数百度以上を必要とし、プラスチックス、金属、低融点ガラス、建材などの材料への利用には制約があった。

【0006】そこで、こうした問題点を解決するために、安定で焼成の容易な被膜形成用塗布剤として、マトリックス成分としてペルオキソポリチタン酸を水等に溶解した状態あるいは分散した状態で含んだ塗布液が特開

平7-286114号公報において提案されている。しかしながら、この発明において開示されている塗布液から得られるチタン化合物は、アナターゼ型の酸化チタンではなく、光触媒活性等を有しているものを得ることはできなかった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、液体中での 分散安定性が高く、塗布後の乾燥、焼成工程が容易で、 緻密な、触媒活性に優れた膜を形成することが可能な、 アナターゼ分散液を提供することを課題とするものであ る。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、アナターゼ分散液において、表面をペルオキソ基を修飾したアナターゼ微粒子が、水中に分散しているアナターゼ分散液である。また、アナターゼ分散液の製造方法において、チタン含有液体から沈殿形成によって形成した水酸化チタン、もしくはチタン酸化物を水中に分散した液に、過酸化物を添加してペルオキソチタン溶液とした後に、ペルオキソチタン溶液を、85℃~200℃において、40時間~2時間の加熱処理を行うアナターゼ分散液の製造方法である。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明のアナターゼ分散液は、ア ナターゼ超微粒子を含み、アナターゼ超微粒子表面に は、ペルオキソ基で修飾されているので、水中に分散し たアナターゼ超微粒子は、その表面のペルオキソ基の分 極によって粒子間の電気的斥力が働くために、凝集する ことなく長期にわたり安定に存在するものとみられる。 【0010】本発明のアナターゼ分散液は、粒径50n m以下の微細なアナターゼ微粒子からなるものであり、 アナターゼ微粒子の粒径が50nmよりも大きくなる と、微粒子に作用する重力による効果が大きくなり、沈 降しやすくなる。このアナターゼ分散液は、常温におい て非常に安定で、溶媒である水以外には特別な助剤を必 要とせず、有機物やハロゲンなどを含まない。また、ア ナターゼ分散液は、ほぼ中性であり、酸によって腐食を 受けやすい金属や建材等の材料にも利用できる。さら に、基体上に塗布して酸化チタン膜を形成する場合に は、基体に対する密着性が良く、低温で緻密化し易い特 徴がある。したがって、塗布乾燥あるいは加熱処理のみ により、従来より低い温度でアナターゼ膜を形成でき、 乾燥のみでも十分実用に耐えるものを得ることができ

【0011】本発明のアナターゼ分散液の製造方法について説明する。アナターゼ分散液は、水酸化チタンゲルあるいは、水中に微粉砕した水酸化チタン、酸化チタン等の超微粒子を分散した液をチタン含有物質の原料とする。水酸化チタンゲルは、塩化チタン、硫酸チタン等の無機チタン化合物の水溶液をアンモニア、水酸化ナトウ

リウム等と反応させる等の方法によって製造したものを 使用することができる。

【0012】次いで、水酸化チタンゲル、酸化チタン等の分散液を、沈殿形成に用いた物質が検出されなくなるまで十分に水洗した後に、過酸化水素水を加えて攪拌すると、黄色のペルオキソチタン酸溶液が得られ、添加した過酸化水素水のうち未反応のものは、放置によって分解を起こす。得られた黄色のペルオキソチタン酸溶液を、85 ℃~200 ℃において、40時間~2時間の加熱処理を行うと、ペルオキソ基を有するアナターゼの結晶核を発生することができる。また、加熱温度は、95 ℃~100 ℃、加熱温度が8時間~4時間とすることが好ましい。

【0013】また、加熱温度が85℃よりも低い場合や、加熱時間が2時間よりも短い場合には、アナターゼ結晶を有する分散液を得ることはできない。また、加熱温度が200℃よりも高い場合には、反応速度が大きくなり、ペルオキソチタン酸溶液からペルオキソ基で修飾したアナターゼ分散液の形成速度を調整することが困難となるともに、高圧下での処理用の設備を要するので好ましくない。また、加熱時間が40時間以上となると、ペルオキソ基が分解しアナターゼ微粒子が凝集を起こすので好ましくない。以上のような処理によって、数nm~50nmの結晶化したアナターゼの微粒子を含む薄黄色の半透明あるいは不透明液体が得られ、アナターゼ表面は、ペルオキソ基が修飾されている。

【0014】本発明のアナターゼ分散液は、チタン以外に酸素と水素しか含まないので、乾燥や焼成によって酸化チタンに変性する場合に水と酸素しか発生しないため、従来のアナターゼ分散液の製造方法では、混入を避けることができなかった炭素成分やハロゲン成分の除去が必要でなく、従来より低温でも比較的密度の高い結晶性のアナターゼ膜を作製することができる。また、pHは中性なので、使用時の人体への影響や基体の腐食などの問題を考慮する必要がない。さらに、室温域で安定性が極めて高く長期の保存に耐える。

【0015】アナターゼ分散液を基体に塗布する場合には、基体との濡れ性を向上させるために、界面活性剤等を添加しても良い。また、不溶性の固体粒子やチタン以外の金属を含む溶液を混合して、種々の用途に適した塗布液として利用することもできる。本発明のアナターゼ分散液を用いアナターゼ膜を作製する場合、セラミックス、陶磁器、金属、プラスチックス、繊維、建材等、用途に応じたあらゆる基体に塗布可能であり、多孔体の内部や粉体の表面処理の目的で使用することも可能である。

表 1

熱処理温度(°C) 生成相 乾燥のみ アナタ-

乾燥のみ アナターゼ 100 アナターゼ [0016]

【実施例】以下に、実施例を示し、本発明をさらに説明 する。

実施例1

四塩化チタンの60重量%水溶液10mlを蒸留水で1000mlとした溶液に2.5重量%アンモニア水を110ml滴下して水酸化チタンを沈殿させた。沈殿物を 濾別し、蒸留水で洗浄後、蒸留水を加えて180mlとした水酸化チタン懸濁液に30重量%過酸化水素水を20ml加えて攪拌した。7℃において24時間放置して余剰の過酸化水素水を分解させて、黄色粘性液体200mlを得た。次いで、得られた液体を100℃で6時間 加熱し、薄黄色半透明の分散液を得た。この液体は常温常圧の下で6カ月放置しても沈殿等の生成等の変化は生じなかった。pHは約7で中性であった。

【0017】得られた分散液を水で100倍に希釈し、 試料保持用シートメッシュ上に滴下し乾燥の後に透過型電子顕微鏡(日本電子製 JEM-2010)によって、加速電圧200kVの条件で観察した。図1に得られた電子顕微鏡写真を示す。図1(A)はアナターゼ超微粒子の外観を示す写真である。図1(B)はアナターゼ結晶の結晶格子像を説明する写真であり、(101)面の格子を示しており、結晶構造の乱れのない結晶構造を有していることを示している。

【0018】また、アナターゼ分散液を、室温で乾燥して得た粉末を臭化カリウム粉末と混合して錠剤を形成した臭化カリウム錠剤法によって、フーリエ変換赤外線吸収スペクトル測定装置(日本分光製 FT/IR-5300)で透過法によって測定し、その結果を図2に示す。矢印で示すようにペルオキソ基の吸収ピークが確認できた。また、アナターゼ分散液を、室温で乾燥し、得られた粉末をX線回折装置(理学電機製 RAD-B)によって、銅ターゲットを用い、加速電圧30kV、電流15mAの測定条件で測定した。その結果を図3に示す。アナターゼのピークが観察され、(101)面のピークの半値幅から結晶の厚みは10nmである。以上の結果から、本発明の分散液は、アナターゼ結晶の微粒子を分散したものであり、さらにアナターゼ結晶の表面には、ペルオキソ基が存在していることが確認された。

【0019】 実施例2

実施例 1 で得た液体を石英基板上に塗布し、各種温度で熱処理した。得られたアナターゼ膜の厚みは約 0.5μ mであった。膜の屈折率から膜の密度を、膜の引っ張り試験から密着性を評価した。それらの膜の物性を表 1 に示す。

[0020]

密度(%) 密着強度(kg/cm²)

6 9 > 1 0 0

70 >100

200	アナターゼ
300	アナターゼ
400	アナターゼ
500	アナターゼ
600	アナターゼ

表1において、「>」は、引っ張り治具を接着させるための樹脂が破壊したことから、密着強度がその破壊強度以上であることを示す。以上の結果から、緻密なアナターゼ膜が密着性良くできることがわかった。

【0021】実施例3

実施例1で作製した液体をスライドガラスに塗布、25 $^{\circ}$ ℃で乾燥し、0.5 $^{\circ}$ $^{\circ}$

【0022】比較例1

実施例 1 と同様に過酸化水素水で処理して製造したチタンを含む黄色液体を、80 で 1 時間加熱し、得られた液体をスライドガラスに塗布し、25 で乾燥し、0.5 μ mの厚みの薄膜を作製し、実施例 3 と同様に硝酸銀

7 6	4 5 0
8 4	5 9 7
8 7	> 7 0 0
9 1	
9.3	

水溶液および赤インキを用いて光触媒特性を測定したが、硝酸銀は60分経過しても色の変化はなく、赤インキは120分経過しても色の退色はほとんどなかった。また、液体を室温で乾燥して得られた粉末を実施例1と同様の条件で測定し、その結果を図4に示す。非晶質を示す起伏のみで、アナターゼは形成されていなかった。

[0023]

【発明の効果】本発明のアナターゼ分散液は長期安定であり、従来よりも高密度の密着性に優れたアナターゼ膜を低温で作製可能であり、焼成によって有害な副生成物が出ず、中性なので取り扱いやすく、種々の基体上に塗布することができる。

【図面の簡単な説明】

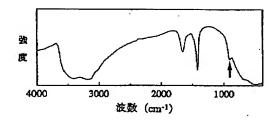
【図1】本発明の一実施例のアナターゼの電子顕微鏡写真をである。

【図2】本発明の一実施例の分散液の赤外吸収スペクトルを説明する図である。

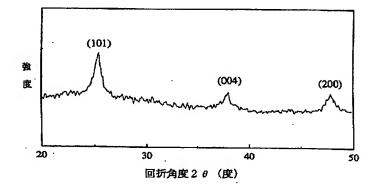
【図3】本発明の一実施例のアナターゼのX線回折試験 結果を説明する図である。

【図4】比較例の分散液のX線回折試験結果を説明する図である。

【図2】

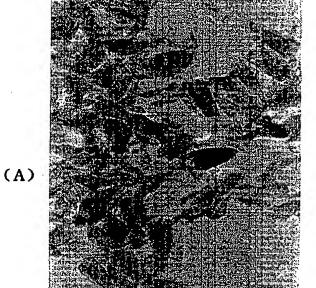


【図3】

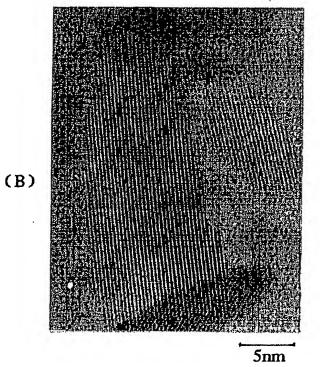


[図1]

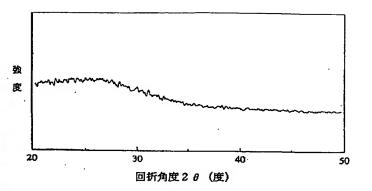




20nm



【図4】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6 C 2 3 C 30/00

識別記号 庁内整理番号

F I C 2 3 C 30/00 技術表示箇所

С

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.